



Chemical highly accurate Mechanical Planarizer

ChaMP



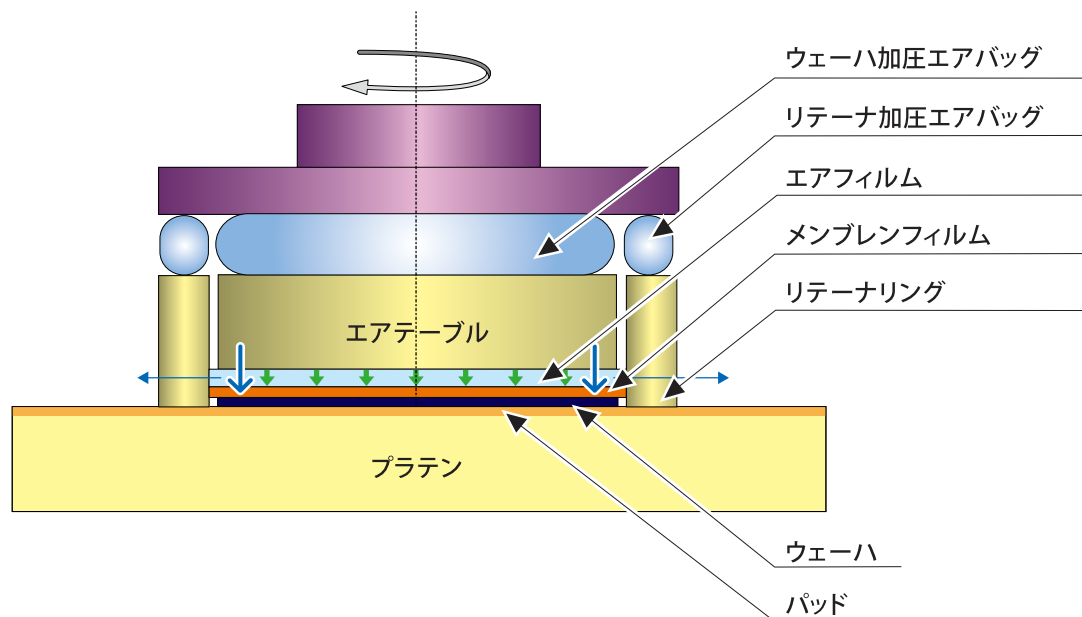
株式会社東京精密

ChaMP

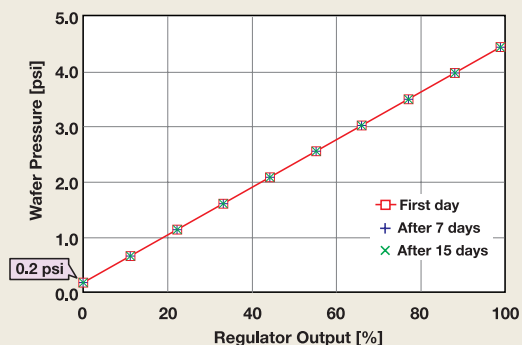
東京精密は、これまで培ってきた精密計測機器及び半導体製造装置の技術を融合し、デザインルール90nmそして65nmのデバイスで要求されるプロセス性能に十分に應えると共に、量産工場における要求にも応えた300mmウェーハ対応CMP装置 ChaMP シリーズを提供いたします。

エアフロート式ヘッド "Sylphide"

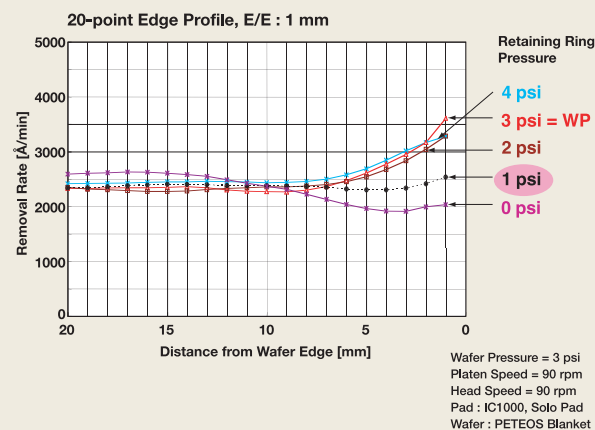
- エアフィルムによる均一な加圧で、表面基準研磨を実現しました。
- エアフィルムと独立したエアバックでウェーハ加圧するため、特に低圧領域での制御性、安定性が良好です。
- ゾーン制御も可能です（オプション）。



ウェーハ加圧の制御性と再現性

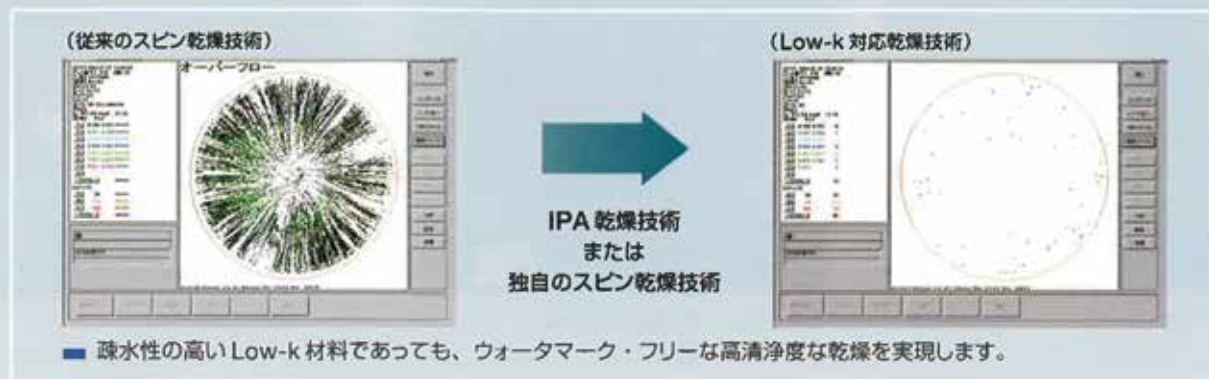


エッジ1mmまで均一に！！



65nm～45nm対応量産プロセスに向けて

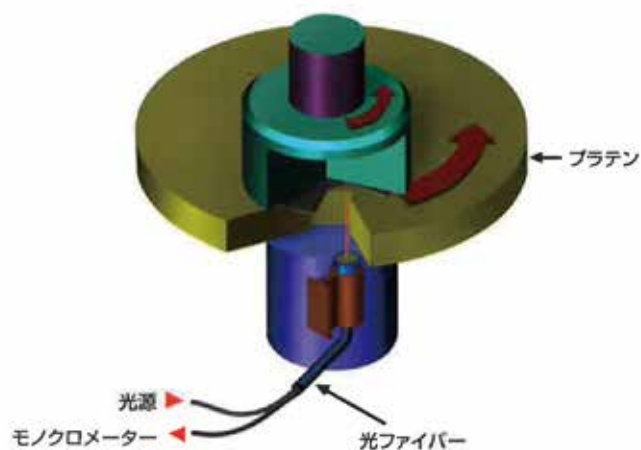
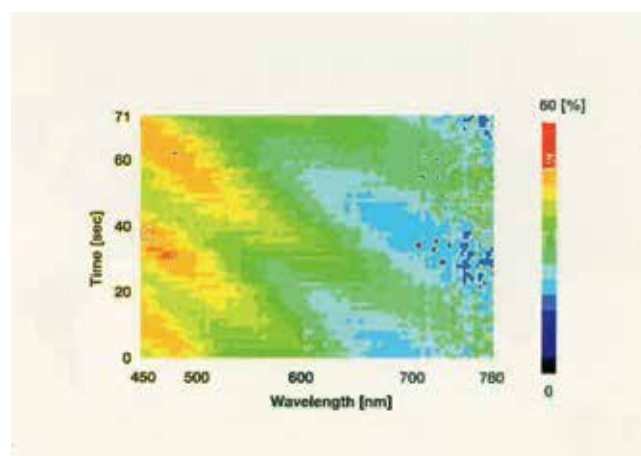
Low-k 対応洗浄技術



生産効率向上、コスト低減に向けたロードマップ



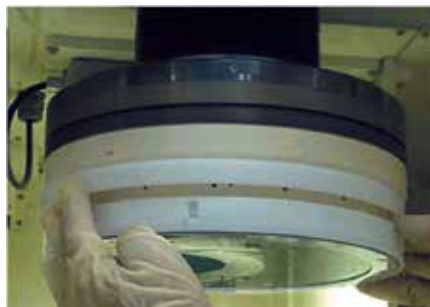
光学式終点検出機構



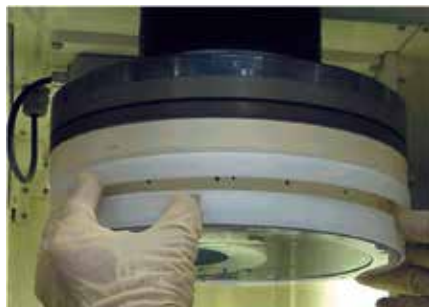
メンテナンスが簡単な研磨ヘッド：研磨ヘッドの交換は不要、1分でメンテナンス完了

簡単なリテーナ・メンブレンの交換作業は装置の停止時間を大幅に低減します。

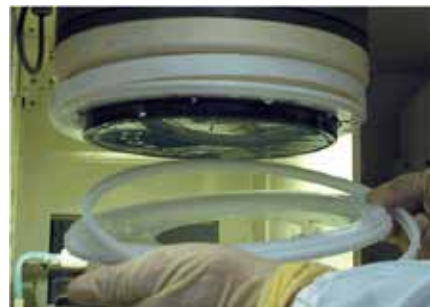
取り外し：およそ5秒



両手でスナップリングカバーを上にはずらす



スナップリングを親指で広げる
リテーナは落ちる



リテーナが外れたところ

取り付け：およそ10秒

- 両手でスナップリングを持ちつつリテーナをキャリアに押し付け、少し回して位置決めピンが入る位置で面を合わせる。
- スナップリングを全周に取り付け、カバーを降ろすだけ。



標準モデル

ChaMP-232

200mm/150mm/100mm ウェーハ対応

ChaMP-332

300mm ウェーハ対応

- 3 プラテン 2 ヘッド構成により
あらゆるアプリケーションに対応しています。
- 300mm/200mm/150mm/100mm ウェーハ対応機は 全て同一コンセプトの研磨ヘッドと EPD システムを搭載しています。

株式会社東京精密

(本社) 〒192-8515 東京都八王子市石川町 2968-2
TEL: (042) 642-1701 FAX: (042) 642-1798
<https://www.accretech.com>

お問い合わせ先

